



# ALLSTRIP

通用型高闪点溶剂, 用于超声波工艺中去除胶黏剂和抛光物。



## 精密光学

功能	污染物
超声波清洗	胶黏剂和抛光物

### 适用材料

- 摄影材料:
  - 蓝宝石
  - 冕牌玻璃和火石玻璃
  - 硼硅酸盐
- 材料:
  - 氟化钙和镁
  - 硅 (Si)
  - 硒化锌
  - 硫化锌
  - 锗
- 材料:
  - 硫族化合物
  - 熔融二氧化硅

### 主要成分

- 不含CMR化合物, 符合REACH标准

### 理化性质

- pH 值 (原液): 不可测
- 密度: 0.99
- 闪点: 88°C

### 使用推荐\*

- 浓度: 100%
- 温度: 20 ~ 50°C (不超过70°C)
- 时间: 2 ~ 10分钟

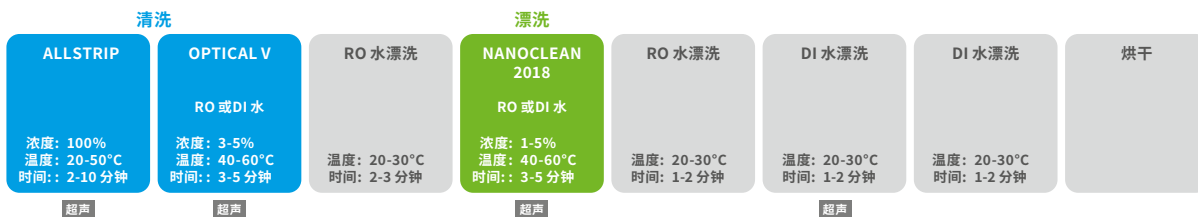
\*在通风良好或者配备排风设备的环境下操作。

### 工艺案例

- 除胶和抛光物工艺



- 去除抛光物, 胶黏剂, 磨料及最终清洗



### 超声波清洗

放大镜/眼镜  
胶黏剂/抛光物

Lapping plate

胶溶解

清洁零件及基材

清洗参数:

T° + % + 时间 + 超声

### 储存条件

- 请在干燥的环境中保持密封储存, 储存温度5~40°C。
- 请保持使用原包装储存(HDPE)。

28/03/23



如有任何疑问, 请联系恩净 (上海) 技术中心, 电话: +86 21 6455 9918

